(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年4 月28 日 (28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/037754 A1

(51) 国際特許分類7:

C07C 37/11, 39/12

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015865

(22) 国際出願日:

2004年10月20日(20.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-361500

2003年10月22日(22.10.2003) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 大塚化学 株式会社 (OTSUKA CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5400021 大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番 27号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 亀島 隆 (KAMESHIMA, Takashi) [JP/JP]; 〒7710193 徳島県 徳島市川内町加賀須野 4 6 3 大塚化学株式会社内 Tokushima (JP).
- (74) 代理人: 三枝 英二, 外(SAEGUSA, Eiji et al.); 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町 1 7 1 北 浜TNKビル Osaka (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

Z

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING 2,3,6,7,10,11-HEXAHYDROXYTRIPHENYLENE

- (54) 発明の名称: 2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサヒドロキシトリフェニレンの製造方法
- (57) Abstract: Disclosed is a simple and efficient method for commercially producing high-purity 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene. The method for producing 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene is characterized by reacting catechol with peroxide.
- (57) 要約: 本発明は、簡便で効率的な高純度2、3、6、7、10、11-ヘキサヒドロキシトリフェニレンの工業的製造法を提供する。本発明は、カテコールと過酸化物とを反応させることを特徴とする2、3、6、7、10、11-ヘキサヒドロキシトリフェニレンの製造方法に関する。